(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. CI. ⁶ H01L 43/08	(11) 공개번호 특 1998-071112 (43) 공개일자 1998년 10월26일
(21) 출원번호 (22) 출원일자	특 1998-003285 1998년 02월 05일
(30) 우선권주장 _. (71) 출원인	97-25601 1997년02월07일 일본(JP) 알프스덴끼가부시끼가이샤
(72) 발명자	일본 도오꾜도 오오따꾸 유끼따니 오오쓰까쵸 1방 7고 나까자와유끼에
	일본 니이가따껭 나가오까시 스미요시 1-6-12-101
	사이또마사미찌
	일본 니이가따껭 나가오까시 후꾸즈미 3-3-5-6에이
	하세가와나오야
	일본 니이가따껭 나가오까시 가와사끼 1-2650-306
	마끼노아끼히로
(74) 대리인	일본 니이가따껭 나가오까시 아오바다이 2-7-11 박해선, 조영원
_ <i>심사청구 : 있음</i>	·

(54) 자기저항효과 소자의 제조방법

요약

본 발명은 적어도 자화가 외부의 자계에 대하여 자유롭게 반전하는 1 총의 프리 강자성층 (14) 과 비자성층 (13) 과 자화반전이 핀고정된 핀고정 강자성층 (12) 을 구비하는 적층체 (15) 를 형성하고, 상기프리 강자성층 (14) 과 핀고정 강자성층 (12) 은 그들의 자화 용이축 방향을 변경하기 위하여 필요한 열처리 조건이 다른 것으로 함과 동시에 제 1 방향으로 자계를 부여하여 소정의 온도로 제 1 어닐링을 행하고, 그 후 제 1 방향과 대략 직교하는 제 2 방향으로 자계를 인가하여 제 2 어닐링을 행하여, 상기 프리 강자성층의 자화 용이축과 핀고정 강자성층의 자화 용이축을 대략 직교시키는 자기저항효과 소자의제조방법이다.

대표도

도1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 본 발명에 따른 제조방법으로 얻어지는 자기저항효과 소자의 제 1 형태의 단면도.

도 2 는 본 발명으로 얻어지는 자기저항효과 소자의 제 2 형태의 단면도.

도 3 은 본 발명에서 실시되는 어닐링시의 인가자계의 방향을 나타내는 것으로서, 도 3(A) 는 제 1 어닐링시의 인가자계의 방향을 나타내는 도면, 도 3(B) 는 제 1 어닐링시의 인가자계의 방향을 나타내는 도면, 도 3(C) 는 각인가자계의 방향과 실시예로 얻어지는 R-H 커브를 측정할 때의 인가자계방향을 나타내는 도면.

도 4 는 실시예로 얻어진 시료의 제 1 어닐링 처리 후의 R-H 커브의 메이저 루프를 나타내는 도면.

도 5 는 실시예로 얻어진 시료의 제 1 어닐링 처리 후의 R-H 커브의 메이저 루프를 나타내는 도면.

도 6 은 실시예로 얻어진 시료의 제 2 어닐링 처리 후의 R-H 커브의 메이저 루프를 나타내는 도면.

도 7 은 실시예로 얻어진 시료의 제 2 어닐링 처리 후의 R-H 커브의 메이저 루프를 나타내는 도면.

도 8 은 종래의 자기저항효과 소자의 일례를 나타내는 구성도.

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

A, B : 자기저항효과 소자 10 : 기판

11 : 반강자성층 12 : 핀고정 강자성층

13 : 비자성층

14 : 프리 강자성층

15, 18 : 적층체

16 : 경강자성충

17 : 전극층

19 : 하지층

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 자기 헤드, 위치 센서, 회전 센서 등에 사용되는 자기저항효과 소자용의 제조방법에 관한 것 이다.

종래, 거대 자기저항효과를 이용한 자기저항효과 소자의 일례로써, 미국특허 제 5,206,590 호 공보에 개시되어 있는 자기저항효과 소자가 공지되어 있다.

이 공보에 기재된 자기저항효과 소자 (A) 는 도 8 에 나타내는 바와 같이, 비자성 기판 (1) 에 연자성체로 이루어자는 제 1 강자성층 (2) 과 비자성층 (3) 과 제 2 강자성층 (4) 과 반강자성층 (5) 을 적층하여 구성된 것으로서, 제 2 강자성층 (4) 의 자화 방향 (B) 이 반강자성층 (5) 에 의한 자기적 교환결합에 의해 고정됨과 동시에 제 1 강자성층 (2) 의 자화 방향 (C) 이 인가자계가 없을 때에 제 2 강자성층 (4) 의 자화 방향 (B) 에 대하여 직각으로 향하고 있다. 단, 이 제 1 강자성층 (2) 의 자화 방향 (C) 은 고정되지 않고 프리 상태로 되어 있기 때문에 외부자계에 의해 회전할 수 있도록 되어 있다.

도 8 에 나타내는 구조에 대하여 인가자계 (h) 를 부가하면 인가자계 (h) 의 방향에 따라 제 1 강자성층 (2) 의 자화 방향 (C) 이 쇄선 화살표와 같이 회전하므로, 제 1 강자성층 (2) 과 제 2 강자성층 (4) 사이에서 자화에 각도차가 생기기 때문에 저항변화가 일어나고, 이에 따라 자계검출을 할 수 있도록 된다.

도 8 에 나타내는 구조의 자기저항효과 소자 (A) 를 제조하는 경우, 반강자성층 (5) 에 의해 만들어지는 교환결합 자계의 방향을 적절한 방향으로 제어함에 있어서는 반강자성층 (5) 을 막형성하는 경우에 소망의 방향 (예컨대, 연자성체로 이루어지는 제 1 강자성층 (2) 의 자화 용이축에 직교하는 방향) 으로 자계를 인가시키는 방법, 또는 각층을 적층한 후, 블로킹 온도를 넘는 온도로 가열한 후, 연자성체로 이루어지는 제 1 강자성층 (2) 의 자화 용이축에 대하여 직교하는 방향으로 자계를 인가하면서 실온까지 급랭하는 열처리를 실시할 필요가 있다.

또한, 상기 구조의 자기저항효과 소자 (A) 에 있어서는, 이와 같은 자계중의 막형성 처리 또는 자계중의 열처리를 실시하여 각 자성층의 자기 이방성을 제어하기 위하여 제 1 강자성층 (2) 의 자화 용이축 방향과 제 2 강자성층 (4) 의 자화 용이축 방향은 동일 방향으로 일치되어 있다.

그러나, 2 개의 강자성층 (2,4) 의 자화 용이축 방향을 동일 방향으로 일치시키는 구조에서는 자화의 회전이 프리로 되어 이루어지는 제 1 강자성층 (2) 의 보자력을 작게 할 수 없어서, 결과적으로 제 1 강자성층 (2) 에서 얻어지는 자화곡선의 마이너 루프에서의 히스테리시스가 커지는 문제가 있다. 그래서도 8 에 나타내는 종래의 구조에서는 바이어스 자계를 많이 인가하여 제 1 강자성층 (2) 의 자화의 회전을 안정화시키는 구조를 채용할 필요가 있었다.

본 발명은 상기 사정을 감안하여 이루어진 것으로서, 자기저항효과와 교환결합자계 등의 필요한 특성을 열화시키지 않으면서 제 1 자성층의 보자력을 낮게 할 수 있고, 출력의 향상과 안정성의 향상 및 자기저 항효과 소자에 필요한 하드 바이어스의 바이어스량 저감을 도모할 수 있는 자기저항효과 소자의 제조방 법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

발명이 이루고자하는 기술적 과제

본 발명은 상기 과제를 해결하기 위하여 적어도 자화가 외부의 자계에 대하여 자유롭게 반전하는 1 총의 프리 강자성층과 비자성층과 자화반전이 핀고정된 핀고정 강자성층을 구비하는 적층체를 형성하고, 상기 프리 강자성층과 핀고정 강자성층은 그들의 자화 용이축 방향을 변경하기 위하여 필요한 열처리 조건이 다른 것으로 함과 동시에 제 1 방향으로 자계를 부여하여 소정의 온도로 제 1 어닐링을 행하고, 그 후 제 1 방향과 대략 직교하는 제 2 방향으로 자계를 인가하여 제 2 어닐링을 행하여, 상기 프리 강자성층 의 자화 용이축과 핀고정 강자성층의 자화 용이축을 대략 직교시키는 것이다.

본 발명은 상기 과제를 해결하기 위하여 상기 제 2 방향의 자계를 제 1 방향의 자계보다 작은 자계, 또 는 핀고정 강자성층의 교환결합자계보다 작은 자계로 하는 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 자계를 1 k Oe ~ 4 k Oe, 상기 제 2 방향의 자계를 50 ~ 400 Oe 로 할 수 있다.

본 발명에 있어서, 상기 제 1 어닐링의 유지온도를 210 ~ 250 ℃, 제 2 어닐링의 유지온도를 반강자성 총의 블로킹 온도 이하 (핀고정 강자성층의 교환결합자계가 소실되는 온도) 로 할 수 있다.

그리고, 본 발명에 있어서 상기 제 2 어닐링의 유지온도를 150 ~ 250 ℃ 로 할 수 있다.

또한, 본 발명에 있어서 상기 프리 강자성층을 NiFe, CoFe, Co 합금 중 어느 하나로 형성하고, 상기 비자성층을 Cu, CuAu, CuNi 중 어느 하나로 형성하고, 상기 핀고정 강자성층을 NiFe, CoFe, Co 중 어느 하나로 형성하고, 상기 핀고정 강자성층을 PtMn, NiMn, IrMn, RhMn, PdMn 중 어느 하나로 이루어지는 반강자성층과 인접시켜 형성할 수 있다.

발명의 구성 및 작용

이하, 도면을 참조하여 본 발명에 대하여 더욱 상세하게 설명한다.

도 1 은 본 발명에 따른 방법으로 제조되는 자기저항효과 소자의 한 형태를 나타내는 것으로서, 이 형태의 자기저항효과 소자 (A) 는 기판 (10) 상에 반강자성총 (11) 과 핀고정 강자성총 (12) 과 비자성총 (13) 과 프리 강자성총 (14) 을 적총하여 단면 사다리꼴 형상으로 형성시킨 적총체 (15) 와, 이 적총체 (15) 의 양측에 형성된 하드 바이어스용 경자성총 (16,16) 과, 각 경자성총 (16) 위에 적총된 전극총 (17) 을 주체로 하여 구성되어 있다.

이 형태의 구조에 있어서 경자성층 (16) 은 그 단부 (16a) 에 있어서 반강자성층 (11) 과 핀고정 강자성층 (12) 과 비자성층 (13) 과 프리 강자성층 (14) 의 측부를 덮어 형성되어 있는데, 각층의 관계는 도면에 나태낸 것에 한정되지 않는다.

상기 기판 (10) 은 유리, Si, Al $_2O_3$, TiC, SiC, Al $_2O_3$ 와 TiC 의 소결체, Zn 페라이트 등으로 대표되는 비자성 재료로 형성된다. 그리고, 기판 (10) 의 상면에는 기판상면의 요철이나 기복을 제거하는 목적 또는 그 위에 적충되는 층의 결정 정합성을 양호하게 하는 등의 목적으로 Ta 등의 비자성 재료로 형성된 피복층이나 버퍼층을 적당히 형성시켜도 된다.

상기 반강자성층 (11) 은 그 위에 형성되는 핀고정 강자성층 (12) 에 자기적 교환 결합력을 작용시켜 핀고정 강자성층 (12) 의 자화 방향을 핀고정하기 위한 것으로서, 이 반강자성층 (11) 은 예컨대 PtMn, NiMn, IrMn, RhMn, PdMn, α - Fe_2O_3 등의 반강자성체로 형성된다.

상기 강자성층 (12,14) 은 모두 강자성체의 박막으로 이루어지는데, 구체적으로는 Ni-Fe 합금, Co-Fe 합금, Ni-Co 합금, Co, Ni-Fe-Co 합금 등으로 이루어진다. 또한, 강자성층 (11) 을 Co 층으로, 강자성층 (14) 를 Ni-Fe 합금층으로, 또는 Co 층과 Ni-Fe 합금층의 적층구조로 구성할 수도 있다. 그라고, Co 층과 Ni-Fe 합금층의 2 층 구조로 하는 경우에는 비자성층 (13) 측에 얇은 Co 층을 배치하는 구조로 할 수도 있다.

이는, 비자성총 (13) 을 강자성총 (12,14) 사이에 까우는 구조의 거대 자기저항효과 발생기구에 있어서는, Co 와 Cu 의 계면에서 전도전자의 스핀 의존 산란 (spin depending scattering) 의 효과가 큰 점, 및 강자성총 (12,14) 을 동종의 재료로 형성하는 편이 이종의 재료로 구성하는 것보다 전도전자의 스핀 의존 산란 이외의 인자가 발생하는 가능성이 낮고, 보다 높은 자기저항효과를 얻을 수 있는 점에 기인하고 있다. 이와 같은 이유로, 강자성총 (12) 을 Co 로 구성한 경우에는 강자성총 (14) 의 비자성총 (13) 측을 소정의 두께로 Co 총을 치환한 구조가 바람직하다. 또한, Co 총을 특별히 구별하여 형성하지 않아도 강자성총 (14) 의 비자성총 (13) 측에 Co 를 많이 함유시킨 합금구조로 하고, 비자성총 (13) 의 반대촉으로 향함에 따라 서서히 Co 농도가 묽어지는 농도 구배층으로 하여도 된다.

상기 비자성층 (13) 은 Cu, Cr, Au, Ag 등으로 대표되는 비자성체로 이루어지고, 바람직하게는 20 ~ 40 Å 의 두께로 형성되어 있다. 여기에서 비자성막 (13) 의 두께가 20 Å 보다 얇으면 강자성층 (12) 과 강자성층 (14) 사이에서 자기적 결합이 일어나기 쉽게 된다. 또한, 비자성층 (13) 이 40 Å 보다 두꺼우면 자기저항효과를 발생시키는 요인인 비자성층 (13) 과 강자성층 (12,14) 의 계면에서 산란되는 전도전자율이 저하되고, 전류의 분류효과에 의해 자기저항효과가 저감되기 때문에 바람직하지 않다.

하드 바이어스층으로서의 상기 경질 자성층 (16) 을 배치함으로써, 프리 강자성층 (14) 에 종 바이어스가 인가되고, 프리 강자성층 (14) 이 단자구화 (單磁區化) 된다. 그 결과, 자기매체로부터의 누설자계의 검출시에 노이즈 (바크하우젠 (Barkhausen) 노이즈) 의 발생을 억제할 수 있다. 상기 경자성층 (16) 은 보자력이 큰 강자성체막, 예컨대 Co-Pt 합금, Co-Cr-Pt 합금으로 이루어지는 것이 바람직하다.

이하, 상기 구조의 자기저항효과 소자 (A) 의 제조방법에 대하여 설명한다.

도 1 에 나타내는 구조의 자기저항효과 소자 (A) 를 제조하기 위해서는 기판 (10) 상에 반강자성총 (11) 과 핀고정 강자성총 (12) 과 비자성총 (13) 과 프리 강자성총 (14) 을 적총하고, 이어서 이것들에 후술하는 조건으로 열처리를 실시하고, 그 후에 이것들을 패터닝기술을 이용하여 트랙 폭에 상당하는 폭을 가지는 단면 사다리꼴 형상의 적총체 (15) 로 가공하고, 그리고 적총체 (15) 의 양촉에 반강자성총 (16) 과 전극총 (17) 을 적총함으로써 제조한다.

상기 각총을 기판 (10) 상에 형성하기 위해서는 범용의 기술, 예컨대 스패터나 증착 등의 박막형성장치를 사용하여 합금박막 등으로 제조하여 형성할 수 있다. 예컨대 막형성장치로서, 고주파 2 극 스패터 장치, DC 스패터, 마그네트론 스패터, 3 극 스패터, 이온 비임 스패터, 대향 타깃식 스패터 등을 이용할 수 있다. 또한, 스패터 타깃으로서 Co 또는 Ni-Fe-Co 합금 타깃상에 첨가원소의 칩을 배치한 복합타깃 등을 사용할 수 있다.

상기 각층을 막형성한 후, 도 3(A) 에 나타내는 바와 같이 핀고정 강자성층 (12) 과 비자성층 (13) 과 프리 강자성층 (14) 을 평면으로 본 경우에 화살표 (a) 방향으로 1 ∼ 4 k 0e, 예컨대 2 k 0e 의 자계를 인가하면서 210 ∼ 250 ℃, 예컨대 230 ℃ 에서 수시간, 예컨대 4 시간 유지한 후 서냉하는 어닐링 처리 를 실시한다.

그리고, 본 발명에 있어서 210 ~ 250 ℃ 란 210 ℃ 이상 250 ℃ 이하를 의미하고, 「~」로 표시하는 수치범위의 상한 하한은 모두 「이상」 및 「이하」 로 규정되는 것으로 한다.

여기에서 가열온도를 210 ℃ 이상으로 하는 것은 핀고정 강자성층 (12) 과 PtMn 의 반강자성층 (11) 과 의 교환결합을 충분히 얻기 위한 것으로, 상한을 250 ℃ 로 한 것은 이보다 높은 온도에서는 비자성층 (13) 계면의 열적 데미지에 의해 △MR 이 강소하기 때문이다. 상기 열처리에 의해 핀고정 강자성층 (12) 과 프리 강자성층 (14) 의 자화 용이축 방향은 모두 a_1 방향으로 된다.

이어서, 도 3(B) 에 나타내는 바와 같이 핀고정 강자성층 (12) 과 비자성층 (13) 과 프리 강자성층 (14) 을 평면으로 본 경우에 화살표 (b) 방향 (상기 a 방향과 직교하는 방향) 으로 50 ~ 400 0e, 예컨 대 100 0e 의 자계를 인가하면서 블로킹 온도 이하인 150 ~ 250 ℃, 더욱 바람직하게는 180 ~ 220 ℃, 예컨대 200 ℃ 에서 수시간, 예컨대 2 시간 유지한 후 냉각하는 어닐링 처리를 실시한다. 여기에서 상한을 250 ℃ 로 한 것은, 이보다 높은 온도에서는 반강자성층 (11) 의 블로킹 온도 (핀고정 강자성층의 교환결합자계가 소실되는 온도) 에 근접하여 H_{ex} (핀고정 강자성층의 보자력) 이 소실될 우려가 있음과 동시에, △MR (자기저항효과) 도 저하되기 때문이다.

상기 자계의 강도와 열처리에 의해 핀고정 강자성층 (12) 의 자화 용이축 방향은 a₁ 방향에서 변화하지 않지만, 프리 강자성층 (14) 의 자화 용이축 방향을 b₁ 방향으로 변화시킬 수 있다.

이상과 같이 2 단계의 자계중 열처리를 하여 제조된 자기저항효과 소자 (A) 는 외부자계가 0 인 상태에서는 도 1 에 나타내는 바와 같이 비자성층 (11) 을 사이에 두고 상하로 인접하는 강자성층 (12, 14) 의 각각의 자화의 방향이 직교하는 방향으로 되는데, 이 자기저항효과 소자 (A) 에 도 1 에 나타내는 Z 방향으로 자기매체로부터의 누설자계가 작용하면 프리 강자성층 (14) 의 자화의 방향이 회전하여 이동하도록 된다. 이 때에 자화의 회전에 따라 저항이 변화하므로, 이 저항변화를 검출함으로써, 역으로 자계가 작용하였는지 아닌지를 검출할 수 있다.

그리고, 상기 구조에 있어서는 핀고정 강자성층 (12) 의 자화 용이축 방향을 도 3(A) 의 a₁ 방향, 프리 강자성층 (14) 의 자화 용이축 방향을 도 3(B) 의 b₁ 방향과 서로 직교시키고 있으므로, 높은 자기저항효 과률 유지한 상대로 자기매체로부터의 누설자계, 도 1 의 Z 방향의 프리 강자성층 (14) 의 보자력을 작 게 할 수 있다. 따라서, 하드 바이어스 구조에 의해 인가하는 바이어스를 종래의 구조보다 얇게 인 가할 수 있도록 되고, 출력의 향상효과를 얻을 수 있음과 동시에 안정성의 향상효과를 얻을 수 있다.

또한, 본 발명의 제조방법은 도 2 에 나타내는 자기저항효과 소자 (B) 에도 적용할 수 있다. 도 2에 나타내는 자기저항효과 소자 (B) 는 기판상에 Ta 등으로 이루어지는 하지층 (19) 과 프리 강자성층 (14) 과 비자성층 (13) 과 핀고정 강자성층 (12) 과 반강자성층 (11) 을 차례로 적층한 단면 사다리끌형상의 적층체 (18) 와 이 적층체 (18) 의 양측에 형성된 하드 바이어스용 경자성층 (16,16) 과 각경자성층 (16) 상에 적층된 전극층 (17) 을 주체로 하여 구성되어 있다. 그리고, 도 2 에서는 결정배향을 조절하기 위하여 기판상에 Ta 등의 비자성 재료로 형성된 하지층 (19) 을 막형성한 후, 프리 강자성층 (14) 을 그 위에 적층하고 있는데, 하지층 (19) 은 적당히 형성시키면 되고, 없어도 된다. 또한, 적층체 (18) 를 보호하기 위하여 보호층을 최상층인 반강자성층 (11) 위에 형성하여도 된다. 이와 같이 형성된 자기저항효과 소자 (B) 의 동작원리에 대하여는 도 1 에 나타내는 자기저항효과 소자 (A) 와 동일하다.

그리고, 도 1 에 나타낸 자기저항효과 소자 (A) 와 마찬가지로 프리 강자성층 (14) 의 비자성층 (13) 측에 Co 를 많이 함유시킨 합금구조로 하고, 비자성층 (13) 의 반대측으로 향함에 따라 Co 농도가 묽어지는 농도 구배층으로 하여도 된다.

<u>실사예 1</u>

고주파 마그네트론 스패터 장치를 사용하여 Al_2O_3 막을 피복한 Si 기판 위에 복수의 타깃을 사용하여 Ta (50 Å)/PtMn (300 Å)/CoFe (30 Å)/CoFe (30 Å)/CoFe (10 Å)/CoFe (10 Å)/CoFe (70 Å)/CoFe (50 Å) 의 적층구조로 되도록 스패터하여 적층체를 형성하고, 이어서 이하의 표 1 에 나타내는 조건으로 2 단계의 자계중 열처리를 실시하여 도 1 에 나타내는 자기저항효과 소자 (A) 를 제조하였다.

이 때 PtMn 은 Pt $_{48}$ Mn $_{52}$ (at%) 의 조성, CoFe 는 Co $_{90}$ Fe $_{10}$ (at%) 의 조성, NiFe 는 Ni $_{80}$ Fe $_{20}$ 의 조성의 것을 사용하였다. 또한, 표 1 의 제 1 어닐링 자계방향은 도 3(A) 의 a_1 방향으로 자계를 인가하면서 어닐링하는 것을 의미하고, 제 2 어닐링 자계방향은 도 3(B) 의 b_1 방향으로 자계를 인가하면서 어닐링하는 것을 의미한다.

[# 1]

[# 1]				
제 1 어닐링 조건과 어닐링 후의 특성				
어닐링온도,인가자 계	△MR (%)	H _{ex} (0e)	H _{cf} (0e)	Free 층의 자화 용이축 방향
210℃× 4HR.2k0e	7.7	500	4	제 1 어닐링 자계방향
230°C× 4HR,2k0e	7.5	700	3	제 1 어닐링 자계방향
	7.5	700 ,	3	제 1 어닐링 자계방향
	7.5	700	3	제 1 어닐링 자계방향
	7.5	700	3	제 1 어닐링 자계방향
	7.5	700	3	제 1 어닐링 자계방향
	7.5	700	3	제 1 어닐링 자계방향
250°C× 2HR.2k0e	7.5	700	3	제 1 어닐링 자계방향
제 2 어닐링 조건과 어닐링 후의 특성				
어닐링온도,인가자 계	△MR (%)	H _{ex} (Oe)	H _{cf} (Oe)	Free 층의 자화 용이축 방향
200°C× 2HR, 50 0e	7.6	500	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향
100℃× 2HR, 50 0e	7.4	700	3	제 1 어닐링
180°C× 2HR, 50 0e				자계방향 (비교예)
200°C× 2HR, 50 0e	7.5	680	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향
220℃× 2HR, 50 0e	7.4	720	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향
200°C× 2HR, 100 0e	7.4	680	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향
200°C× 2HR, 200 0e	7.5	700	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향
	7.4	660	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향
200°C× 2HR. 50 0e	7.3	700	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향

: Si 기판/알루미나/Ta 50Å/PtMn 300 Å/CoFe 30Å/Cu 22Å/CoFe 10Å/NiFe 70Å/Ta 50Å

표 1 에 나타내는 각시료의 스MR (저항 변화율), H_{ex} (핀고정 강자성층의 교환결합자계), H_{er} (도 3 의 a 방향의 프리 강자성층의 보자력, 즉 자기매체로부터의 누설자계, 도 1 의 Z 방향의 보자력) 의 값으로부터 밝혀지는 바와 같이, 제 1 어닐링 자계방향과 제 2 어닐링 자계방향을 90 도 바꾸어 실시한 시료에 있어서는 자계방향을 바꾸지 않고 처리한 비교예 시료에 비하여 스MR, H_{ex} 의 값은 동일하면서도 H_{er} 의 값이 작아져 있는 것이 명백하다. 이 H_{er} 의 값이 작아지면 자기기록매체로부터의 누설자계에 의해 프리 강자성층의 자화의 회전이 이루어지는 경우에 자화의 회전이 높은 안정성을 가지고 이루어진다. 또한, H_{er} 의 값을 작게함으로써 하드 바이어스 구조에 의해 인가하는 바이어스를 작게 할 수 있으므로 출력을 향상시킬 수 있다.

고주파 마그네트론 스패터 장치를 사용하여 Al_2O_3 막을 피복한 Si 기판 위에 복수의 타깃을 사용하여 Ta $(50 \, \text{\AA})/\text{PtMn} \ (200 \, \text{Å})/\text{CoFe} \ (30 \, \text{Å})/\text{CoFe} \ (10 \, \text{Å})/\text{NiFe} \ (70 \, \text{Å})/\text{CoFe} \ (10 \, \text{Å})/\text{CoFe}$

[# 2]

제 1 어닐링 조건과 어닐링 후의 특성				
어닐링온도,인가자 계	△MR (%)	H _{ex} (Oe)	H _{cf} (Oe)	Free 층의 자화 용이축 방향
210℃× 4HR.1k0e	10.5	400	4	제 1 어닐링 자계방향
230℃× 4HR.2k0e	10.3	600	3	제 1 어닐링 자계방향
250 ℃× 2HR 4k0e	10.0	600	4	제 1 어닐링 자계방향
제 2 어닐링 조건과 어닐링 후의 특성				

어닐링온도,인가자 계	△MR (%)	H _{ex} (Oe)	H _{cf} (Oe)	Free 층의 자화 용이축 방향
200°C× 2HR, 100 0e	10.4	440	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향
200°C× 2HR, 100 0e	10.2	600	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향
200°C× 2HR, 100 0e	10.1	580	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향

: Si 기판/알루미나/Ta 50Å/PtMn 200Å/CoFe 30Å/Cu 22Å/CoFe 10Å/NiFe 70Å/CoFe 10Å/Cu 22Å/CoFe 30Å/PtMn 200Å/Ta 50Å

표 2 에 나타내는 각시료의 스MR, H_{ex}, H_{ef} 의 값으로부터 밝혀지는 바와 같이, 이 시료의 구조에서도 제 1 어닐링 자계방향과 제 2 어닐링 자계방향을 90 도 바꾸어 실시한 시료에 있어서는 표 1 의 시료와 동일한 H_{ef} 의 값으로 되어 있는 것이 명백하다. 따라서, 이 예의 적층구조에서도 자화의 회전이 높은 안정성을 가지고 이루어지고, 하드 바이어스를 작게 할 수 있으므로 출력을 향상시킬 수 있다.

또한, 표 2 에 나타내는 구조에서는 Ta (50Å) 상의 PtMn (200Å) 와 Ta (50Å) 하의 PtMn (200Å) 이모두 핀고정 강자성층으로 이루어지고, 두 개의 Cu (22Å) 사이에 끼워진 CoFe (10Å)/NiFe (70Å)/CoFe (10Å) 가 프리 강자성층을 구성하는 듀얼 타입의 구조로서, 이 구조로 하는 편이 표 1 에나타내는 구조보다 높은 스MR 을 얻을 수 있는 것도 명백해졌다.

도 4 와 도 5 는 표 1 에 나타낸 시료에 있어서, 표 1 의 어닐링 (230 ℃ × 4 시간, 2k 0e) 후에 얻어 진 시료의 R-H 커브의 메이저 루프 (핀고정 강자성층의 R-H 커브) 와 마이너 루프 (프리 강자성층의 R-H 커브) 를 나타내고, 도 6 과 도 7 은 제 2 어닐링 (200 ℃ × 2 시간, 100 0e) 후에 얻어진 시료의 R-H 커브의 메이저 루프 (핀고정 강자성층의 R-H 커브) 와 마이너 루프 (프리 강자성층의 R-H 커브) 를 나타낸다.

도 4 내지 도 7 에 나타내는 결과로부터, 2 단계의 어닐링을 실시함으로써, 프리 강자성층의 보자력이 작아져 있는 것이 명료하게 되었다.

실시예 2

이어서, 실시예 1 과 동일하게 하여, Ta (50Å)/NiFe (70Å)/CoFe (10Å)/Cu (25Å)/CoFe (30Å)/PtMn (300Å)/Ta (50Å) 의 적층구조로 되도록 스패터하여 적층체를 형성하고, 이어서 표 3 에 나타내는 조건으로 2 단계의 자계중 열처리를 실시하여 도 2 에 나타내는 자기저항효과 소자 (B) 를 제조하였다. 이 때의 PtMn, CoFe, NiFe 의 조성은 실시예 1 과 동일하다.

[# 3]

제 1 어닐링 조건과 어닐링 후의 특성				
어닐링온도,인가자	△MR (%)	H _{ex} (Oe)	H _{cf} (0e)	Free 층의
계				자화 용이축 방향
230°C× 10HR,2k0e	6.5	700	3	제 1 어닐링 자계방향
250°C× 10HR,2k0e	6.0	800	4	제 1 어닐링 자계방향
제 2 어닐링 조건과 어닐링 후의 특성				
어닐링온도,인가자	△MR (%)	H _{ex} (Oe)	H _{cf} (0e)	Free 층의
계				자화 용이축 방향
250°C× 3HR, 50 0e	6.2	650	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향
270°C× 3HR, 50 0e	5.8	700	≤ 0.5	제 2 어닐링 자계방향

표 2 에 나타내는 각시료의 \triangle MR, H_{ex} (핀고정 강자성층의 교환결합자계), H_{ef} (프리 강자성층의 보자력, 즉 자기매체로부터의 누설자계, 도 2 의 Z 방향의 보자력) 의 값으로부터 밝혀지는 바와 같이, 제 1 어닐링 자계방향과 제 2 어닐링 자계방향을 90 도 바꾸어 실시한 시료에 있어서는 자계방향을 바꾸지 않고어닐링한 비교예 시료에 비하여 \triangle MR, H_{ex} , H_{ef} 의 값이 작아져 있는 것이 명백하다. 따라서, 실시예 1 과 마찬가지로 H_{ef} 의 값을 작게 함으로써 하드 바이어스 구조에 의해 인가하는 바이어스를 작게 할 수 있으므로 출력을 향상시킬 수 있다.

발명의 효과

이상 설명한 바와같이, 본 발명에 따라 제조되는 자기저항효과 소자에 의하면, 자기저항효과와 교환결 합자계 등의 필요한 특성을 열화시키지 않으면서 제 1 자성층의 보자력을 낮게 할 수 있고, 출력의 향상 과 안정성의 향상 및 자기저항효과 소자에 필요한 하드 바이어스의 바이어스량 저감을 도모할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1

자화가 외부의 자계에 대하여 자유롭게 반전하는 원중을의 프리 강자성층과 비자성층과 자화반전이 핀고정

된 핀고정 강자성층을 구비하는 적총체를 형성하고, 상기 프리 강자성층과 핀고정 강자성층을 그들의 자화 용이축 방향을 변경하기 위하여 필요한 열처리 조건이 다른 것으로 함과 동시에, 제 1 방향으로 자계를 부여하여 소정의 온도로 제 1 어닐링을 행하고, 그 후 제 1 방향과 대략 직교하는 제 2 방향으로 자계를 인가하여 제 2 어닐링을 행하여, 상기 프리 강자성층의 자화 용이축과 핀고정 강자성층의 자화 용이축을 대략 직교시키는 자기저항효과 소자의 제조방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 제 2 방향의 자계를 제 1 방향의 자계보다 작은 자계로 하거나, 또는 인접하는 반강자성층에 의해 자화를 핀고정된 핀고정 강자성층의 교환결합자계보다 작은 자계로 하는 자기저항효 과 소자의 제조방법.

청구항 3

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 방향의 자계를 1 k 0e ~ 4 k 0e, 상기 제 2 방향의 자계를 50 ~ 400 0e 로 하는 자기저항효과 소자의 제조방법.

최구화 4

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 어닐링의 유지온도를 210 ~ 250 ℃, 제 2 어닐링의 유지온도를 반강자성 층의 블로킹 온도 이하로 하는 자기저항효과 소자의 제조방법.

청구항 5

제 4 항에 있어서, 상기 제 2 어닐링의 유지온도를 150 ~ 250 ℃ 로 하는 자기저항효과 소자의 제조방법.

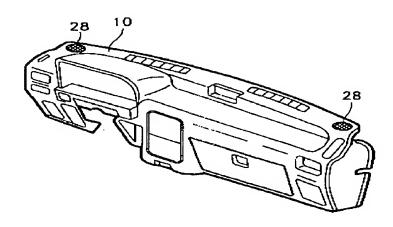
청구항 6

제 1 항에 있어서, 상기 프리 강자성층을 NiFe, CoFe, Co 합금 중 어느 하나로 형성하고, 상기 비자성층을 Cu, CuAu, CuNi 중 어느 하나로 형성하고, 상기 핀고정 강자성층을 NiFe, CoFe, Co 중 어느 하나로 형성하고, 상기 핀고정 강자성층을 PtMn, NiMn, IrMn, RhMn, PdMn, RuMn 중 어느 하나로 이루어자는 반 강자성층과 인접시켜 형성하는 자기저항효과 소자의 제조방법.

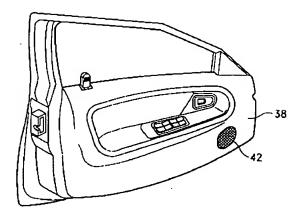
도면

도면1

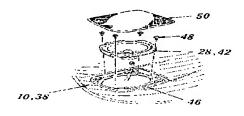
도면2



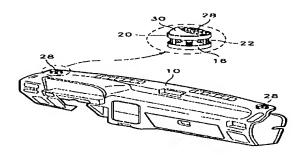
도면3



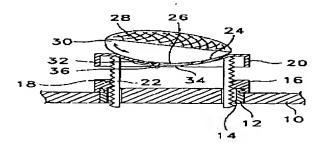
도면4



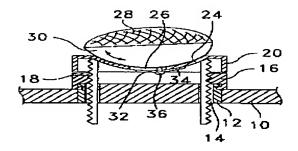
도면5



도면6



도면7



도연8

